

**(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG**

**(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro**



A standard linear barcode is located at the bottom of the page, spanning most of the width.

**(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
19. Februar 2004 (19.02.2004)**

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/015754 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 21/316
21/321, 21/762, 21/322, 21/32, 21/763

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): CHUNG, Hin-Yiu [DE/DE]; Daimlerstrasse 10, 89160 Dornstadt (DE). GUTT, Thomas [DE/DE]; Truderinger Strasse 2, 82008 Unterhaching (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/002523

(74) Anwalt: KARL, Frank; Patentanwälte Kindermann,
Postfach 1330, 85627 Grasbrunn (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
26. Juli 2003 (26.07.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): CN, JP, KR, SG, US.

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(30) Angaben zur Priorität: 102.34.694.1 30. Juli 2002 (30.07.2002) DE

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

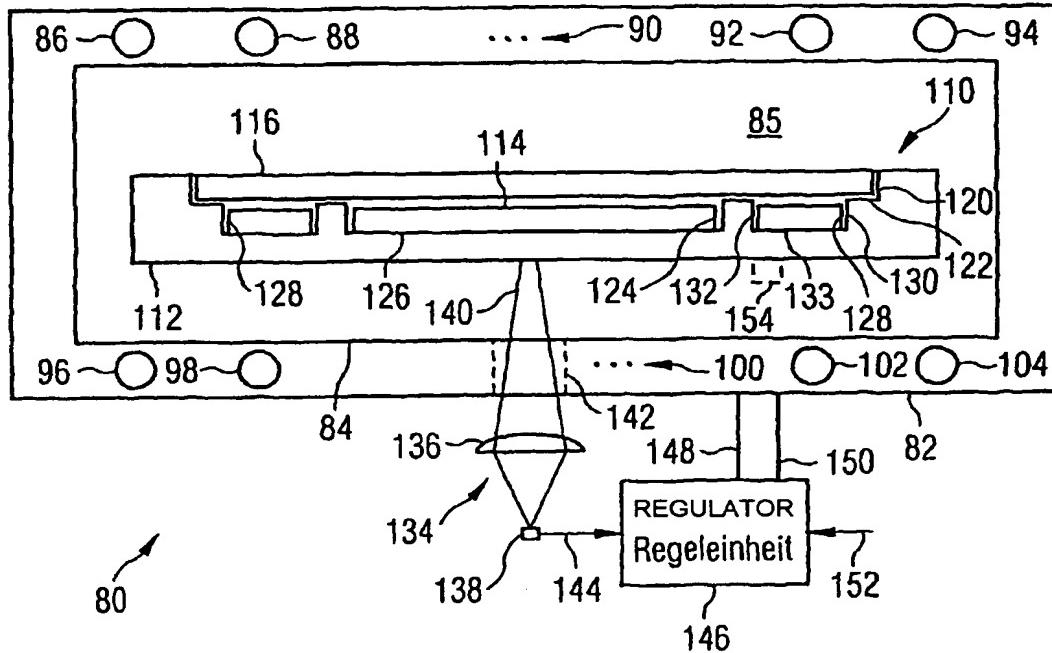
(71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US*): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St. Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 21. Mai 2004

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR OXIDATION OF A LAYER AND CORRESPONDING HOLDER DEVICE FOR A SUBSTRATE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM OXIDIEREN EINER SCHICHT UND ZUGEHÖRIGE AUFNAHMEVORRICHTUNG FÜR EIN SUBSTRAT



(57) Abstract: Amongst other things a method is disclosed, whereby a layer for oxidation is preferably processed in a single substrate process, whereby the process temperature during the processing is recorded directly on the substrate or on a holder device (110) for the substrate. Oxide layers with precisely fixed oxide widths can be generated.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

In1243TW

Abstract

Method for oxidizing a layer, and associated holding devices for a substrate

The invention explains, inter alia, a method in which a layer which is to be oxidized is processed, preferably in a single-substrate process, the process temperature during the processing being recorded directly at the substrate (114) or at a holding device (110) for the substrate. It is possible to produce oxide layers with an accurately predetermined oxide width.

(Figure 3)